

无掩模数字光刻机



产品特点:

- 采用数字微镜 (DMD) 的无掩模扫描式光刻机，365nm波长
- 直接从数字图形生成光刻图案，免去制作掩模板的中间过程，支持直接读取GDSII和BMP文件
- 全自动化的对焦和套刻，易于使用
- 晶圆连续运动配合DMD动态曝光，无拼接问题。全幅面绝对定位精度0.1um
- 套刻精度：0.2um
- 500 nm / 1 um分辨率，100mm x 100mm最大幅面（4~6寸晶圆），满幅面曝光时间5~30分钟
- 500um最小线宽
- 可灰度曝光（128阶）
- 尺寸小巧，可配合专用循环装置产生内部洁净空间

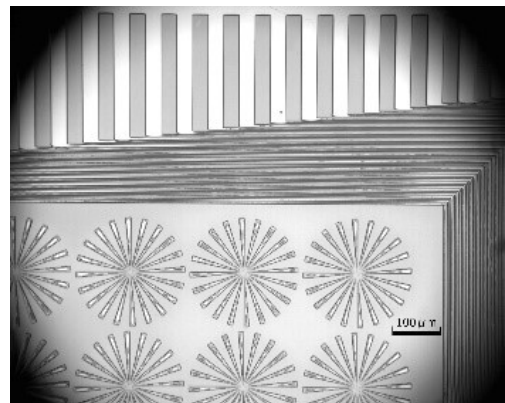
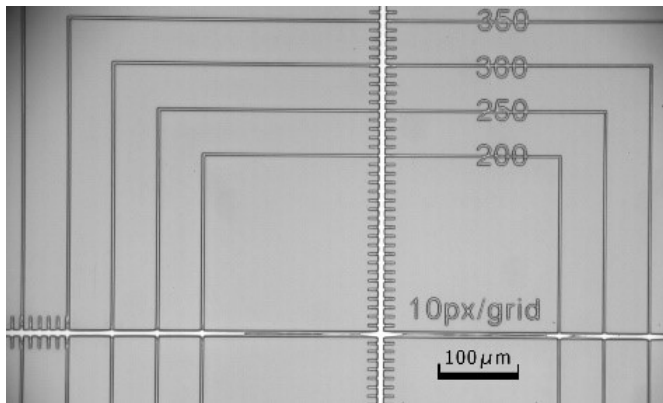
产品应用:

- 微流控、生物芯片、MEMS、功率器件、LED等试制加工
- 带有2.5D图案的微光学元件，衍射光器件制作
- 教学、科研



产品参数:

	MCML-110A	MCML-120A
波长	365nm	365nm
最大帧	100mm x 100mm	100mm x 100mm
分辨率	1.0um	500nm
灰度光刻	64 levels	128 levels
最大曝光量	500mJ/cm ²	2000mJ/cm ²
对准精度	<200nm	<100nm
场曲率	< 1 um	< 1 um
速度	5mm ² /sec	2.5mm ² /sec
输入文件	BMP, GDSII	BMP, GDSII
Z级精度	<1 um	<1 um
环境	20~25 °C	20~25 °C



(SU8-2002, 2um胶厚, 2寸硅基底)